

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 11 月 24 日 (24.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/112108 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/68, 21/02  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/009107  
(22) 国際出願日: 2005 年 5 月 12 日 (12.05.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願2004-146113 2004 年 5 月 17 日 (17.05.2004) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野三丁目 1 4 番 2 0 号 Tokyo (JP).

東中野三丁目 1 4 番 2 0 号 株式会社日立国際電気  
内 Tokyo (JP).(74) 代理人: 守山 辰雄, 外 (MORIYAMA, Tatsuo et al.);  
〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目 7 番 1 0 号  
第 6 ミトモビル 8 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

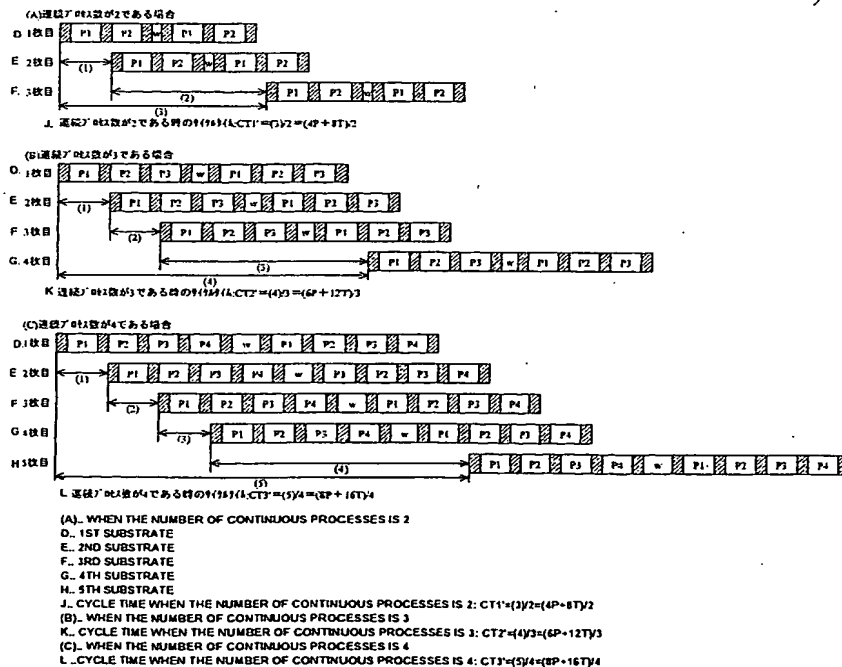
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高野 智  
(TAKANO, Satoshi) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理装置及び半導体デバイス製造方法



(57) Abstract: A substrate processing apparatus for continuously processing substrates efficiently performs substrate processing having a return process. The substrate processing apparatus has a conveyance chamber as a conveyance space for substrates, processing chambers in which the substrates are processed, substrate conveyance means provided in the conveyance chamber

[続葉有]

ATTACHMENT "G"



BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

- AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特

許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ 特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)の指定のための出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))

- USの指定のための先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て (規則4.17(iii))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

and having a function of conveying the substrates, and substrate conveyance control means for controlling conveyance of the substrates by the substrate conveyance means. The control by the substrate conveyance control means is made such that, in the execution of a return process in which substrates are continuously processed by two or more processing chambers and then reconveyed for processing to any processing chamber other than the last one of the two or more processing chambers, the substrates are temporarily receded, in the reconveyance, at a place other than the processing chambers and then conveyed to the any processing chamber.

(57) 要約: 複数の基板を連続的に処理する基板処理装置で、戻りプロセスを有する基板処理を効率的に行う。基板の搬送空間となる搬送室と、基板の処理が行われる複数の処理室と、前記搬送室に設けられて基板を搬送する機能を有する基板搬送手段と、基板を2つ以上の処理室により連続的に処理した後、最後の処理室から当該2つ以上の処理室のうちの最後以外のいずれかの処理室へ前記基板を再度搬送して処理を行う戻りプロセスを実行する場合に、当該再度搬送するに際して、前記基板を処理室以外の場所で一時的に退避させた後に前記いずれかの処理室へ搬送するように前記基板搬送手段による基板の搬送処理を制御する基板搬送制御手段と、を備えた。